デバイス構造を用いたダイヤモンド中 NV センタの光電流検出

Photocurrent detection of NV centers in diamond using a device structure

東工大¹, 産総研², ^O(M1)椎貝 雅文¹, (D)室岡 拓也¹, (M2)楊 棒¹ 牧野 俊晴², 加藤 宙光², 小倉 政彦², 山崎 聡², 波多野 睦子¹, 岩崎 孝之¹,

Tokyo Tech¹, AIST², ^oM. Shiigai¹, T. Murooka¹, B. Yang, T. Makino², H. Kato², M. Ogura²,

S. Yamasaki², M. Hatano¹, and T. Iwasaki¹

E-mail: shiigai.m.aa@m.titech.ac.jp

ダイヤモンド中のNVセンタは高感度な磁気センサへの応用が期待されている。NVセンタによるセンシングは電子スピンの状態を読み出すことで行うが、その方法としては緑色レーザを照射した際にNVセンタが発する蛍光を検出する光学的検出が一般的である。しかし光学的検出ではダイヤモンドの高い屈折率により光取り出し効率が3%程度と低い。この問題を解決する方法として、NVセンタの電子を伝導帯へ励起し光電流として読み出す電気的手法がある[1, 2, 3]。この電気的検出では光電流の検出効率がセンサ感度に直結する。そこで本研究では半導体デバイス技術を応用した光電流検出の高効率化を目的とし、pinダイオードを利用したNVセンタの光電流検出を行った。

本研究では、厚さ 500 µm の IIb (111)ダイヤモンド基板(ボロ ン濃度: ~10¹⁷ cm⁻³)上に MPCVD を用いて 5 µm の i 層と、0.5 µm の n 層 (リン濃度 : ~10¹⁹ cm⁻³)を形成した縦型の pin ダイオード を使用した。作製した pin ダイオードの断面模式図を Fig. 1 に 示す。NV センタはデバイスの上部から窒素イオン(¹⁴N⁺⁺)をド ーズ量 10¹² cm⁻²、加速電圧 350 keV で注入し、その後 750 °C、 30 分間アニールして形成した[4]。Fig. 2 にバイアスを印加せず に測定した光電流のレーザパワー依存性を示す。その結果、光 電流はレーザパワーの二乗に比例して増加していることがわ かった。これは NV センタの電子が基底準位から伝導帯へ二段 階で励起されるためである。そして、本実験ではバイアスを印 加していないのにも関わらず光電流を検出することができた。 これは n 層と i 層の接合部に形成された内部電界による効果だ と考えられる。

本研究は MEXT Q-LEAP (JPMXS0118067395)と科研費 (18H01472)の支援を受けております。

[1] E. Bourgeois et al., Nat. Commun. 6, 8577 (2015).
[2] M. Gulka et al., Phys. Rev Applied. 7, 069901 (2017).
[3] H. Morishita et al., arXiv (2018).
[4]T. Iwasaki et al., ACS Nano, 11, 1238-1245(2017).







